DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008286946

WPI Acc No: 1990-173947/*199023*

XRAM Acc No: C90-075658 XRPX Acc No: N90-135000

Photoreceptor for electrophotography - has rough hydrogenated amorphous silicon or carbon photoconductive layer coated with binder and lubricant layers

Patent Assignee: HITACHI CHEM CO LTD (HITB); HITACHI LTD (HITA)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

<u>Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week</u>
JP 2111962 A 19900424 JP 88264093 A 19881021 199023 B

Priority Applications (No Type Date): JP 88264093 A 19881021

Abstract (Basic): JP 2111962 A

The photoreceptor has (A) a photoconductive layer on (B) conductive supporting base. The photoconductive layer is a rough-surfaced layer composed of hydrogenated amorphous silicon (or hydrogenated amorphous carbon). The photoconductive layer is coated with organic binder layer and surface-protective lubricant-layer having perfluoro-poly-oxyalkyl (or perfluoro-polyoxyalkylene) backbone.

Pref. overall film thickness of the organic binder layer and the surface-protective lubricant layer is 10-300 nm. Instead of forming an extra layer, surface-protective lubricant having non-fluorochemical segment and the fluorochemical segment may be incorporated in the organic binder layer.

USE/ADVANTAGE - By coating the amorphous-silicon-based photoconductive layer of the photoreceptor with the surface-protective layer contg. the fluorochemical lubricant, moisture resistance of the photoreceptor is improved without affecting its abrasion resistance. (6pp Dwg.No.0/0)ing

Title Terms: PHOTORECEIVER; ELECTROPHOTOGRAPHIC; ROUGH; HYDROGENATION; AMORPHOUS; SILICON; CARBON; PHOTOCONDUCTIVE; LAYER; COATING; BIND; LUBRICATE; LAYER

Derwent Class: A89; G08; P84; S06

International Patent Class (Additional): G03G-005/08

File Segment: CPI; EPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): A10-E08; A12-L05D; G06-A08; G06-F07; G06-H17

Manual Codes (EPI/S-X): S06-A01A2; S06-A01B

Plasdoc Codes (KS): 0210 0231 1279 3251 2654 2657 2658 2726 2729 2806 2808 Polymer Fragment Codes (PF):

001 014 04- 062 064 147 443 445 477 53& 532 533 535 575 596 597 598 599 609 658 659 725

Derwent Registry Numbers: 1520-U

 	 ·			 	
				•	•
					•
	eden geste de la come de la come La come de la come de La come de la come de		is a secular of transportage of throughout all the control of the sequence of		
			•		
			*		

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平2-111962 ⑫ 公 關 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成2年(1990)4月24日

G 03 G 5/08

3 0 9

7381 - 2H

審査請求 未請求 競求項の数 6 (全6頁)

❷発明の名称 電子写真感光体

20特 頭 昭63-264093

顧 昭63(1988)10月21日 忽出

沼 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 加発 明 者 小 魚 春 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 (2)発 明 若 石 111 文 紀

究所内

⑦発 明 者 木 政 利 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 若 究所内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 勿出 願 人 株式会社日立製作所 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 の出頭 人 日立化成工獎株式会社

個代 理 人 弁理士 中 本 外1名 #

最終頁に続く

1. 発明の名跡

冠子写真名光体

- 2 特許額求の顕出
 - 1. 與現在悠坂上に必光団を有する電子写真悠光 体において、前記線光型が表面に凹凸を有する 水米化アモルファスシリコン系材料又は水泉化 アモルファスカーポン系材料の増から成り、核 感光質の表面には有機パインダー質とパーフル オロポリオキシアルキルグループ又はパーフル オロポリオキシアルキレングループを負格とす る表面保護期間目が形成されていることを特徴 とする電子写真昭光体。
 - 2. 専用性盛飯の表面に凹凸が形成されており、 該蓝板上の水泉化アモルファスシリコン果材料 又は水気化アモルファスカーポン果材料の歯か らなる感光性の表面は、前記海風性底板表面の 凹凸に沿つて凹凸が形成されており、鉄炮光磨 の表面には有腹隔分子フィルムによるパインダ 一溜が形成されており、前記パインダー畑には

パーフルオロポリオキシアルキルグルーナ文は パーフルオロポリオキシアルキレングループと 非フツ東含省グループを符合した構造の個層間 が含有されて知り、該脳前周は非フツ杂合有グ ループがパインダー当中に固定され、パーフル オロポリオキシアルキルグループ又はパーフル オロポリオキシアルキレングループがパインダ - 一世安面に歴史的に析出して装面保護淵清遺を 形成していることを特徴とする鬼子写真感光体。 前記忍光切は、水袋化アモルファスシリコン 果材料の増がa-Si:H:B,a-SiC:H:B. a-SiC : H , a - SiGe : H , a - SiGe : H : B . a-SIN: Hより成る群から遊ばれた一種又は二 世以上の図から成り、水名化アモルファスカー ポン系材料の目がa - C : H , a - C : H : 7 から避ばれた一組以上の过から成り、また、放 協允切の設面図がa - SIC : II . a - SIN : H. a - C : H , a - C : H : P 上り成る群から避 はれた一種又は二位以上の誰から成ることを特 散とする和水頂1又は2配成の電子写真腐光体。

わせて10~300nm であることを特徴とす 小さく、樹塚純性に劣るなどの欠点を有している。

ポリオキシアルキルグループ又はパーフルオロ グループを結合した構造の調料剤を含有した有 することを特徴とする請求項1又は2記載の還 ているが十分とは云えない。 子写真成光体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(植薬上の利用分野)

印刷しても良好左頭像を形成させるのに好適な水 ため、例えば特額昭61-22361号明細谷に 泉化アモルフアスシリコン系温光体に選する。 〔従来の技術〕

0 8 4 8 号公報に配成されているように熱可塑性 関脂質を設ける方法がある。しかし、上記方法で **社計温性と電子写真思光体の表面保護園として模** 求される他の特性即ち耐塞能性、クリーニング性 とが心らずしも並立しないという問題があり、特 化フツ岩米材料を表面保護別に用いる場合には、 謝恩性が大きく向上するものの削碌氏性及びクリ ーエング性が苦しく劣化すると云う欠点があつた。 [発明が解決しようとする限題】

上記述法技術では闖子写真忽光体の表面保護す として要求される謝理性、附保徳性及びクリーニ ング性の各々の特性を満足するには至らず、印字 プロセスの繰り返し後に商溢化で画線流れが発生 し、 a-Si:H 忍光体の欠点を十分に克服できない という問題があつた。

水発明の目的は、電子写真窓光体にかいて、顧 湿性、消染化性及びクリーニング性に優れた設所 保護関を設けるととにより、繰り返し使用しても 変質しない技術命の感光体を提供することにある。 (原選を解決するための手段)

6. 凹凸を有する忍光葡萄面上に、パーフルオロ 呆窓光体は硬度が高く、峭壁発性に優れているこ とから長寿命の電子写真感光体として明待されて ポリオキシアルキレングループと非フツ表含有 いる。しかしながらa-Si:H 悠光休には耐湿性に 劣るという欠点がある。このため、 a-SiC :H々 假属分子パインダー潜を形成してのち、漁処理 どを表面保護者として設けることが一般的となつ

電子写真の印字プロセスにおいては、コロナ放 電による帯電プロセスが存在するため、甲字プロ セスの様り返しにより表面保護性が離化し前温性 本務期は電子写真濫光体に保り、特に高湿下で が劣化する。とのような謝湿性の劣化を防止する 記載されているようにα-C:H:F膜、あるい

> 本発明者らは、鋭度研究の結果、上記目的は、 核光智装面に凹凸を有するa-Si: H系及光体の 後表面に、有限高分子パインダーほど有限フッ共 不の表面保護間滑階とを順次形成することにより 迷成されるととを見い出し、本希明を完成した。

> - ナなわち、本発明は、導電性益板上に窓光頭を 有する電子写真悠光体において、前記悠光層が設 面に凹凸を有する水素化アモルファスシリコン系 材料又は水栽化アモルファスカーポン系材料のほ から成り、該窓光型の表面には有限高分子パイン ダー関とパーフルオロポリオキシアルキルグルー プ又はパーフルオロポリオキシアルキレングルー プを骨格とする装面保護網滑盤が形成されている ととを特徴とする電子写真窓光体に関し、また、 導電性基板の表面に凹凸が形成されており、該法 板上の水素化アモルファスシリコン系材料又は水 単化アモルファスカーポン系材料の質からなる沼 光圀の安面は、前記導電性基板表面の凹凸に沿つ て凹凸が形成されており、鉄窓光質の表面には有 被高分子フィルムによるパインダー質が形成され

ており、前記パインダー魁にはパーフルオロポリオキシアルキルグループ又はパーフルオロポリオキシアルキレングループと非フツ流含有グループを結合した構造の潤滑刷が含有されており、 籔児 湖川は非フツ宏含有グループがパインダー 型中に 個定され、パーフルオロポリオキシアルキルグループがパインダー 型表面に選択的に析出して表面保益開州盟を形成していることを特徴とする選子写真必光体に測する。

前配過消削の非フツ公会有グループはパインダー海中に埋込固定されることにより、コロナ照射後の射世性に優れ、耐感発性、クリーニング性にも近れる電子写真恣光体を突現できる。

本発明に用いる調料剤は下記一般式

$$R_1 - (R_1 - (R_2)_m - (R_3 - \sqrt{\bigcirc})_m - H)_m$$

(式中Rf はパーフルオロ化ポリオキシアルキル基、又はパーフルオロ化ポリオキシアルキレン
茲、

$$R_{f} - CH_{g} - O \longrightarrow O \longrightarrow O$$

$$R_{f} - CH_{g} - (-O \longrightarrow O)_{g} - O \longrightarrow O$$

$$R_{f} - COOC_{g}H_{4} \longrightarrow O$$

$$R_{f} - CO(OC_{g}H_{4})_{4} - OCH_{g} \longrightarrow O$$

$$R_{f} - CONH \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow NHCO \longrightarrow O$$

$$R_{f} - CONH \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow C(CH_{3})_{g} \longrightarrow O$$

$$-O \longrightarrow NHCO \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow C(CH_{3})_{g} \longrightarrow O$$

(式中、R_I パーフルオロポリオキシアルキル グループ又はパーフルオロポリオキシアルキレン グループ)

本発明に用いる有國商分子パインダーは特に限定されないが、 硬化後少なくとも一部架 幅していることが必要である。 a-S1:H 感光体の場合、硬化温度が存過ぎると感光型中の水気が脱酸し、光

はな性などの電子写真特性が低下するため、パイ

削記Rfが、パーフルオロ化ポリオキシアルキルグループの場合は下記一般式

F(C₂P₆-O-)₂-(CP₈O)_y-(CP₈)₂-パーフルオロ化ポリオキシアルキレンダループの 場合は下記一般式

- { (C₁F₄O-)_V-(CF₂O)_Z-CF₂}-

(式中 4 、 y 、 z は 1 以上の整数、望ましくは とは 5 以上、 y は 1 0 ~ 2 5、 z は 1 0 ~ 5 6) で示されるものである。とれらのフツ案化合物の 例はデユポン社から市坂されているクライトック ス 1 4 5 あるいはモンテフルオス社のホンブリン Y、ホンブリン 2 などがある。

前記機構剤の具体的な例としては

ンダーとしては300℃以下選至しくは250℃ 以下で硬化するものが好適である。

次にa-Si:H 感光体表面にパインダー 智、姿質 保護機構質を形成する方法の代表例を示す。バー フロロポリオキシアルキルグループ又はパーフロ ロポリオキシアルキレングループをもつ構造の間 **捐刷と適当な公知の三次元硬化型パインダー剤あ** るいはR可密性のパインダー剤とを、これらが良 く俗俗する有級俗別、例えばメナルエチルケトン と酢液ブチルセルソルブ、フロンソルベントの進 合したものに俗解する。その後、この治液の痰を 退光型最画に形成する。形成の方法は浸渍法、回 転進布法など適宜避んで良い。その後、 B C∼12 C ℃で15~21程度の燃処理を施し溶剤を旅発さ せる。この政府でパーフロロオキシアルキル並は パインダーとの具和性が小さいため、パインダー 脳表面に選択的に折出し、表面保護調解過を形成 する。非フツ森含有グループはパインダー圏中に 堪込固定される。次いで180~300℃の温度 凝固内で1~3hの無処理を行うととにより、パ

インダー 増の 保橋が 促逸されて パインダー 心中への非フッポグループ の 固定がより 強固なものになると共に、 表面 保 投 潤 骨 智 の 形 成 も 完成 する。

パインダー図と表面保護機構別の厚さは、厚適 ぎると冠子写真特性の内題留記位を増大させるな と好文しくなく、適常は両者合せて1.0.nm~300... nm が用いられ、符に100cm 以下が観文しい。 吸厚100cm 以下では上述の有機属分子図を形成しても、光辺促性、帯電特性などに何ら影響を 及ぼすことはない。

また、表面保護協滑層は、密光層のは出部に対 する該装面保護制滑層のは出部の影面類比が1以 上とするのがよい。

[寒荡例]

以下、本語明の一例を第1図により説明するが 太危明はこれらの原施例に限定されるものではな い。

兴施例1

河 1 図は本発明による a - S1 : H 窓光体の機研 信を模式的に示した機断面図である。外壁 6 262 × 浸さ 4 5 0 mmの A ℓ ドラム 近体 1 0 交通に 1 μm 以下 a 1 μm 以上の凹凸を形成した。凹凸の 保さ は 皮面 保 質 閏 1 3 の 全 概 遅 に 依 存 し、 最 適 に は そ の凹凸は a 5 μm が 良い。 また、 延 4 投 面 を 凹凸 ン果材料の別は、 a - C : H , a - C : H : Fの 一般又は二額から成り、また、該 窓光質の表面がは、 a - SiC : H , a - SiN : H , a - C : H , a - C : H , a - C : H , a - C : H , a - C : H , a - C : H , a - C : H , a - C : H , a - C : H . F より成る群から迎ばれた一種又は 二種以上の型からたるものが用いられる。

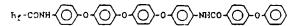
そして、30個性拡振の表面に凹凸を形成することにより、忽光組にも同様な凹凸を形成し、拡板 表面と忽光辺の付着性をよくすることができる。 (作用)

化することによつて必光図101の付着性が労大 し、蝦制艦を防止する。

この基体上に代設例としてa-SiC:H:Bのブロッキング間11を2 μm、a-SiC:Hの設面保護額13を0.5 μm 破蹊した。ことで、ブロッキング圏にはこの他にa-SiC:H,a-SiN:H、電荷発生般送別には受破投高限度化をはかるためa-SiOa:H、設面保護圏にはa-SiN:H、a-C:H。a-C:H。a-C:H。a-C:H。a-C:H。a-C:H。な一般により、高別には 2 億以上の資値に プラズマC V D 接限により、高別には 7 5 0 0 で、放電に 1 0 1 の成機は プラズマC V D 接限により、高別と近方 5 0 0 で、放電に力 6 7 Pa、基体保護 2 5 0 で、反応ガス総流量 4 0 0 sccm の作製条件である。

次にとの窓光体をプラズマ C V D 接望より取り出し、本発明になる有機表面保護図 2 0 1 を溢布した。原布度として、メチルエチルケトン 1 3 0 0 g、酢酸エチレングリコールモノー n - ブチルエーテル 1 3 0 9、フロンソルペント 6 5 9 を温ぜ合わせた容剛に、エポキン姆脂 4 4 9、フェノー

ル 3 6 5 0 9 、 トリエチルアンモニウムカリボール塩 0 0 4 9 を混合し、化学制造式が



(式中 R_f はF(CF(CF₃)-CF₂O-)_n-CF(CF₃)-でn=平均14)
で示される恐情剤23を049をさらに混合した
ものを作製した。との存放に上述の a - Si - H 感
光体を受演して、表面に有機パインダー型を成談した後100℃1hの予備加熱、200℃2hの 加熱硬化を施して有酸姿面保證型201を完成した。成蹊後の加熱により、有機パインダー圏21
の表面に関済剤のパーフロロボリオキシアルキル 造が空向析出し、姿面保証潤滑型22が形成され 有機パインダー母21中に潤滑剤の非フツ名含有 グループが埋込却定される。

このようにして得た悠光体をレーザビームブリンタに実改し恒温恒恒室内にて印字杖紋を行つた。 恒温恒恒室内の温度を20℃から25℃の範囲に、 また、相対湿度を放布80分まで変化させた。こ の時、悪象洗れは頻改されず良好な田字性能が得

(発明の効果)

4. 図面の簡単な説明

10 ··· A L 蓝体 11 ··· プロツキング質

101 ··· a - Si : H 总光 划

2 1 … 有機パインダーゼ

22…有微数面保護調情增

2 3 … 油滑剂

201 …有被收面保護型

られた。

突焰例 2

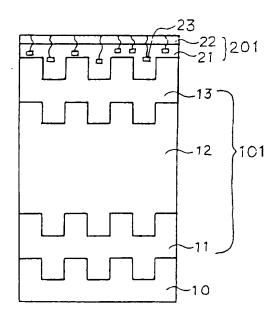
契施例1と同様にして a - S1: H 形光体を作製し、次いで契施例1の独布液のうち、 間滑別を第1 要に示す7 種類に変えて有機表面保証別を形成した。得られた忽光体を契施例1と同様条件にて中学試験を行ったがいずれも頭像流れは発生せず良好を用字性能を示すことを認めた。

第 1 获

Ha	15年 16年 18月 18月 18月
	Rf-CH:-0-@-0-@
2	R(-CH;-(0-0-)2-0-0
5	H_C-COUC, H(0)
4	Rf-C0(0C; H,)4-9CH; -(0)
5	. (0)-0-(0)-NHCO-R1-CONH-(0)-0-(0)
6	R;-соин-(0)-0-(0)-инсо-(0)
,	В1-соин-(о)-о-(сн1)1-(о)-о-(о)-инсо-(о)-о-(о)

(式中RfはF(CF(CF:)-CF:0-)n-CF(CF:)-でロ=平均14]

第 1 図



持開平2-111962(6)

第1頁	夏の制	きき					
個発	明	者	玉	楯	邦	裕	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内
⑦発	明	者	華	团	雅	侰	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内
@発	明	者	庄	司	Ξ	良	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研
Service of the	****	e there was		, almor outer to April sector	(G) 12 () 1.		完所内
個発	明	者	中	川路	孝	行	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研
							究所内
個発	明	者	伊	膜		豐	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研
0,0		_					究所內
個発	明	者	小	松崎	茂	樹	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研
⊕ 7€	-73	פר		124	~		究所内
⇔ ≈	a a	者	ய	岸	智	明	茨城県日立市東町 4 丁目13番地 1 号 日立化成工業株式会
@発	明	台	ш	17	8	-71	公 从从中国内